' PAT-NO:

JP409260742A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 09260742 A

TITLE:

MAGNETORESISTANCE EFFECT DEVICE

PUBN-DATE:

October 3, 1997

INVENTOR-INFORMATION: NAME HASHIMOTO, MINORU SUGAWARA, NOBUHIRO YAOI, TOSHIHIKO KANO, HIROSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SONY CORP

N/A

APPL-NO:

JP08070018

APPL-DATE:

March 26, 1996

INT-CL (IPC): H01L043/08, G01R033/09

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To To provide an MR device in which stable magnetoresistance can be obtained, even when the width of a soft magnetic material is narrowed.

SOLUTION: This MR device has a soft magnetic material 1, a rear end electrode 4 connected to one end in the longitudinal direction of the soft magnetic material 1 and a front-end electrode 5 connected to the other end of the soft magnetic material 1. Magnetic domain stabilizing materials 2 and 3, which can generate bias magnetic fields having components parallel to the width direction of the soft magnetic material 1, are arranged on both ends in the width direction of the soft magnetic material 1. Consequently, if the bias magnetic fields which overcome magnetostatic anisotropy in the longitudinal direction can be applied, the magnetizing direction D<SB>f</SB> of the single-layered soft magnetic material 1 is oriented in the width direction. The electrical resistance of the magnetic domain stabilizing materials 2 and 3 is greater than that of the soft magnetic material 1, thereby suppressing the loss of a sense current i. Such an MR device 10 is preferably and for a so-called vertical MR head.

COPYRIGHT: (C)1997, JPO

5/9/06, EAST Version: 2.0.3.0

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-260742

(43)公開日 平成9年(1997)10月3日

(51) Int.Cl.6	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H01L 43/08			H 0 1 L 43/08	В
G01R 33/09			G01R 33/06	R

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 11 頁)

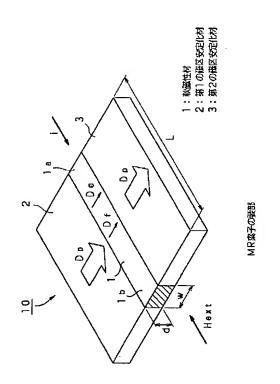
		TI-11 34/
(21)出願番号	特顏平8-70018	(71)出願人 000002185
		ソニー株式会社
(22)出願日	平成8年(1996)3月26日	東京都品川区北品川6丁目7番35号
		(72)発明者 橋本 実
		東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
		一株式会社内
		(72)発明者 菅原 伸浩
		東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
		一株式会社内
		(72)発明者 矢迫 俊彦
		東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
		一株式会社内
		(74)代理人 弁理士 小池 晃 (外2名)
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 磁気抵抗効果素子

(57)【要約】

【課題】 軟磁性材の幅を狭くしても、安定した磁気抵抗特性が得られる磁気抵抗効果素子 (MR素子)を提供する。

【解決手段】 軟磁性材1と、該軟磁性材1の長手方向の一端部に接続される後端電極4と、該軟磁性材1の他端部に接続される先端電極5とを備え、軟磁性材1の幅方向の両端側に、該軟磁性材1の幅方向に平行な成分を有するバイアス磁界を発生可能な磁区安定化材2、3が配設される。これにより、長手方向の静磁的な磁気異方性に打ち勝つだけのバイアス磁界を印加することができれば、単層の軟磁性材1の磁化方向Dfが幅方向に向くようになる。磁区安定化材2、3の電気抵抗は軟磁性材1の電気抵抗よりも大きくなされ、これにより、センス電流iの損失を抑制する。このようなMR素子10は、いわゆる縦型MRへッドに適用されて好適である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 軟磁性材と、該軟磁性材の長手方向の一端部に接続される第1の電極と、該軟磁性材の他端部に接続される第2の電極とを備えた磁気抵抗効果素子において、

前記軟磁性材の幅方向の両端側に、該軟磁性材の幅方向 に平行な成分を有するバイアス磁界を発生可能な磁区安 定化材が配設されていることを特徴とする磁気抵抗効果 素子。

【請求項2】 前記磁区安定化材が、前記軟磁性材の長 10 手方向の一端部から他端部に亘って連続的に配設されて いることを特徴とする請求項1記載の磁気抵抗効果素 子。

【請求項3】 前記磁区安定化材が、前記軟磁性材の長手方向の一端部のみ、あるいは、前記軟磁性材の長手方向の両端部のみに配設されていることを特徴とする請求項1記載の磁気抵抗効果素子。

【請求項4】 前記磁区安定化材の電気抵抗が、前記軟磁性材の電気抵抗より大きいことを特徴とする請求項1記載の磁気抵抗効果素子。

【請求項5】 前記磁区安定化材と前記軟磁性材との間 に、絶縁材が介在されていることを特徴とする請求項1 記載の磁気抵抗効果素子。

【請求項6】 前記磁区安定化材が、硬磁性材料膜であることを特徴とする請求項1記載の磁気抵抗効果素子。 【請求項7】 前記磁区安定化材が、軟磁性材料膜と硬磁性材料膜との積層膜であることを特徴とする請求項1

磁性材料膜との積層膜であることを特徴とする請求項 記載の磁気抵抗効果素子。

【請求項8】 前記磁区安定化材が、反強磁性体膜であることを特徴とする請求項1記載の磁気抵抗効果素子。 【請求項9】 前記磁区安定化材が、軟磁性材料膜と反強磁性体膜との積層膜であることを特徴とする請求項1記載の磁気抵抗効果素子。

【請求項10】 磁気シールド間に挟み込まれることにより磁気ヘッドを構成し、磁気記録媒体の信号記録面に対して前記軟磁性材の長手方向が垂直となるようにして用いられることを特徴とする請求項1記載の磁気抵抗効果素子。

【請求項11】 前記磁区安定化材が、前記軟磁性材における前記磁気記録媒体と対向する一端部から前記磁気 40シールド間の間隔に相当する長さ以上後方まで配設されていることを特徴とする請求項10記載の磁気抵抗効果素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、単層の軟磁性材を 用いた磁気抵抗効果素子に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、磁気抵抗効果を有する磁性膜を用いた磁気抵抗効果素子(以下、MR素子と称す

る。)は、磁界を検出する素子として、磁気センサ、磁 気ヘッド、回転検出素子、位置検出素子等として用いら れている。

2

【0003】ここで、図16に、最も単純なMR素子110の構成を示す。このMR素子110は、幅W、長さしの単層の軟磁性材101が、その磁化容易軸方向Deが幅方向と平行となるように形成され、該軟磁性材101の長手方向の両端部に図示しない電極がそれぞれ配設されてなる。このようなMR素子110においては、外部磁界Hextによって軟磁性材101の抵抗変化が生じるはずであり、電極間にセンス電流iを流せば、該電極間の電圧変化として、外部磁界Hext 検出できるはずである。

【0004】しかしながら、実際に上述のMR素子11 0に、長手方向に平行な方向から外部磁界Hext を印加 したときの磁化を測定すると、図17に示されるよう に、非常に大きなヒステリシスを生じ、また、電気抵抗 を測定すると、図18に示されるように、外部磁界Hex tに伴う抵抗変化が現れない。これは、軟磁性材101 の長手方向の静磁的な磁気異方性が、磁化容易軸方向D 。の物性的な磁気異方性を上回るために、軟磁性材10 1の磁化方向Df が磁化容易軸方向D。を向くことがで きないためである。

【0005】このため、このようなMR素子110を例 えば磁気ヘッドに適用するに際しては、外部磁界Hext (この場合、信号磁界である。) の方向が軟磁性材の磁 化容易軸方向D。と平行となるように構成されてきた。 なお、以下、外部磁界Hextの方向に軟磁性材の磁化容 易軸方向De が垂直となるようにMR素子を配する磁気 ヘッドを縦型MRヘッドと称し、外部磁界Hext の方向 に軟磁性材の磁化容易軸方向De が平行となるようにM R素子を配する磁気ヘッドを横型MRヘッドと称するこ ととする。しかしながら、上述したような横型MRへッ ドにおいては、電極間の間隔にてトラック幅が定められ ることとなるため、狭トラック化には限界があった。 【0006】そこで、軟磁性材の幅によってトラック幅 を定めることができ、且つ、軟磁性材の磁化方向を磁化 容易軸方向 De に向かせることができるような縦型MR ヘッドを構成するため、非磁性膜を介して2層の軟磁性 材が積層されてなるMR素子が考えられた。図19に示 されるように、このMR素子120は、第1の軟磁性材 102および第2の軟磁性材103が図示しない非磁性 膜を介して積層されると共に、両軟磁性材102、10 3の長手方向の両端部に図示しない電極がそれぞれ配設

【0007】このようなMR素子120においては、両 軟磁性材102、103間の静磁気的な相互作用によっ て互いの磁化方向Dfが影響を受けること、電極間に流 すセンス電流iによって両軟磁性材102、103内に 50 所定方向の電流磁界Hiが生じることを利用して、両軟

されてなる。

3

磁性材102、103の磁化方向Df を磁化容易軸方向 De に向かせることができる。このような構成のMR素子120であれば、磁化容易軸方向De に垂直な方向からの外部磁界Hext によっても、両軟磁性材102、103の磁化方向Df が回転し、抵抗変化が生じる。【0008】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このM R素子120に、磁化容易軸方向De に垂直な方向から外部磁界Hext を印加したときの磁化を実際に測定すると、図20に示されるように、ヒステリシスを有する磁 10 化曲線しか得られない。なお、電気抵抗は図21のようになる。但し、図20および図21は、両軟磁性材102、103の幅が2.5μmのときの特性であり、この幅を狭くするほど、外部磁界Hext に対する磁化曲線、抵抗曲線ともヒステリシスが大きくなる。例えば、両軟磁性材102、103の幅が0.5μmのときの抵抗曲線は、図22に示されるように、大きなヒステリシスを有するものとなってしまう。

【0009】図23にMR素子120の断面を示すように、上述したような現象は、第1の軟磁性材102およ 20 び第2の軟磁性材103の面積が異なっていることによって起こる。第1の軟磁性材102、非磁性膜104、第2の軟磁性材103よりなる積層体を所定形状にパターニングするに際し、その断面が垂直となるようにエッチングすることは困難であり、通常、エッチング後の積層体の側面は、90°未満の所定角度θを有する斜面となってしまうのである。

【0010】そして、MR素子120において、第1の軟磁性材102の幅と第2の軟磁性材103の幅とに差が生じていると、両軟磁性材102、103の端面に生 30じる磁極磁界の大きさに差が生じてしまう。このため、外部磁界Hextが印加されていない状態でも、図24に示されるように、両軟磁性材102、103内の磁化方向Dfが、磁化容易軸方向Deを向くことができなくなるのである。なお、MR素子120の幅が狭くなるほど、このような現象が顕著になるのは、両軟磁性材102、103の幅を狭くするほど、両者の幅の差が無視できなくなってくるためである。

【0011】従来の係る実情を鑑みて、本発明においては、軟磁性材の幅を狭くしても、安定した磁気抵抗特性 40が得られるMR素子を提供することを目的とする。 【0012】

【課題を解決するための手段】本発明に係るMR素子は、上述の目的を達成するものであり、軟磁性材と、該 軟磁性材の長手方向の一端部に接続される第1の電極 と、該軟磁性材の他端部に接続される第2の電極とを備 え、軟磁性材の幅方向の両端側に、該軟磁性材の幅方向 に平行な成分を有するバイアス磁界を発生可能な磁区安 定化材が配設されているものである。

【0013】なお、ここでいうバイアス磁界とは、交換 50 電極の少なくともいずれかに非接触とされる必要があ

バイアス磁界を含むものである。

【0014】磁区安定化材の保磁力が十分に大きければ、磁区安定化材と軟磁性材とが隣接する領域において、磁区安定化材の磁化と軟磁性材の磁化とが強磁性結合し、軟磁性材の磁化方向Dfが磁区安定化材の磁化方向Dpと同じ方向を向くようになる。このようにして、長手方向の静磁的な磁気異方性に打ち勝つだけのバイアス磁界を印加することができれば、単層の軟磁性材であっても磁化方向Dfが幅方向に向くようになる。なお、軟磁性材の磁化容易軸方向Deを幅方向に設定しておけば、比較的小さなバイアス磁界で、軟磁性材の磁化方向Dfを幅方向に向けることができるが、十分に大きなバイアス磁界を印加できるならば、軟磁性材の磁化容易軸方向Deを幅方向に設定しておく必要もない。

【0015】そして、本発明を適用して、軟磁性材の磁化方向Df を幅方向に向けることができれば、軟磁性材の磁化分布が単磁区状態に安定化されるため、MR素子の磁気抵抗特性をヒステリシスを有さない安定化なものとすることができる。

【0016】なお、磁区安定化材は、軟磁性材の幅方向の両端側に、該軟磁性材の長手方向に平行な中心線に対して対称となるように配設されるならば、軟磁性材の一端部から他端部の間のいずれの位置に配設されてもよい。軟磁性材の長手方向の一端部から他端部に亘って連続的に配設されれば、軟磁性材全体に亘って磁区の安定化を図ることができるようになる。

【0017】但し、軟磁性材の両端に磁区安定化材が接触していると、第1の電極と第2の電極との間にセンス電流を流す際に、磁区安定化材内にセンス電流が漏れる 虞れがある。そして、この漏れ電流は磁気抵抗を検出しないため、漏れ電流によって軟磁性材内に流れる電流が損失すると、その分、軟磁性材の磁気抵抗比は低下することとなる。電流の損失を抑制するには、磁区安定化材を、軟磁性材の長手方向の一端部のみ、あるいは、軟磁性材の長手方向の両端部のみに配設し、軟磁性材の長手方向の両端部のみに配設し、軟磁性材の長手方向の両端部のみに配設し、軟磁性材のもち第1の電極と第2の電極との間の実質的に感磁部となる領域には磁区安定化材を接触させないようにすることが有効である。

【0018】また、磁区安定化材の電気抵抗を軟磁性材の電気抵抗より大きくすることによっても、電流の損失を抑制できる。この場合、軟磁性材の実質的に感磁部となる領域に磁区安定化材を接触させても、センス電流の殆どが軟磁性材内を流れるようになるため、電流損失を抑制することができるようになる。

【0019】さらに、磁区安定化材と軟磁性材との間に 絶縁材を介在させることによっても、電流の損失を抑制 できる。但し、絶縁材を介在させても、磁区安定化材が 第1の電極と第2の電極との両方と接触していては電流 が損失するため、磁区安定化材は、第1の電極と第2の 電極の少なくともいずれれて非接触とされる必要があ る。このような構成とすれば、磁区安定化材が軟磁性材 の長手方向の一端から他端に亘る全領域に配設されて も、電流の損失は殆ど生じなくなる。

【0020】ここで、磁区安定化材としては、硬磁性材 料膜、軟磁性材料膜と硬磁性材料膜との積層膜、反強磁 性体膜、軟磁性材料膜と反強磁性体膜との積層膜が挙げ られる。いずれの構成においても、強磁性結合を利用し て、軟磁性材の磁化方向Dfを磁区安定化材の磁化方向 D_p と同じ方向に揃えることができる。

【0021】以上のような構成を有するMR素子は、縦 10 型MRヘッドに適用されて好適である。この場合、上述 のMR素子が磁気シールド間に挟み込まれ、磁気記録媒 体の信号記録面に対して前記軟磁性材の長手方向が垂直 となるようにして用いられる。上述のMR素子が縦型M Rヘッドに適用されるに際しては、磁区安定化材が軟磁 性材における磁気記録媒体との対向面に臨む一端部から 磁気シールド間の間隔(即ち、磁気ギャップg)に相当 する長さ以上後方まで配設されて好適である。

[0022]

【発明の実施の形態】以下、本発明を適用したMR素子 20 の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明 する。

【0023】第1の実施の形態

図1および図2に本実施の形態に係るMR素子10を示 す。このMR素子10は、厚さd=15nm、幅W= 0.5μ m、長さL= 4μ mの単層の軟磁性材1と、該 軟磁性材1の幅方向の両端側にそれぞれ配設された第1 の磁区安定化材2および第2の磁区安定化材3とを備え る。また、このMR素子10は、軟磁性材1の長手方向 の一端部(ここでは便宜的に後端部と称す。)1aに接 30 続される後端電極4、該軟磁性材1の他端部(ここでは 便宜的に先端部と称す。) 1 bに接続される先端電極5 を備えている。

【0024】ここで、軟磁性材1は、外部磁界Hext に よって磁化方向Df が回転するものである。したがっ て、上述のMR素子10においては、この軟磁性材1の 抵抗変化を利用して外部磁界 Hext の検出を行うことと なる。この軟磁性材1においては、第1の磁区安定化材 2および第2の磁区安定化材3からのバイアス磁界が十 分に大きければ、その磁化容易軸方向D。がいずれの方 向に設定されていてもよいが、ここでは、磁化容易軸方 向D。が幅方向と平行となるように形成されている。

【0025】第1の磁区安定化材2および第2の磁区安 定化材3は、軟磁性材1の幅方向に平行な成分を有する バイアス磁界を発生可能なものであり、このバイアス磁 界により、軟磁性材1の磁化方向Df を制御することが できる。ここでは、第1の磁区安定化材2および第2の 磁区安定化材3の磁化方向D。は、軟磁性材1の幅方向 と平行方向となされている。また、第1の磁区安定化材

の両端側に、該軟磁性材1の長手方向に平行な中心線に 対して対称となるように配設されるならば、いずれの位 置に配設されてもよい。ここでは、第1の磁区安定化材 2および第2の磁区安定化材3が、軟磁性材1の後端部 1 aから先端部1 bに亘る全領域に配設されている。

【0026】後端電極4および先端電極5は、後端電極 4から先端電極5に向かって軟磁性材1内にセンス電流 iを流すため、軟磁性材1の長手方向の両端部1a、1 **b上に重なるごとく設けられたものである。ここでは、** 後端電極4は、軟磁性材1の幅Wより広い幅にて軟磁性 材1の長手方向に延在しており、軟磁性材1の後端部1 aのみならず隣接する磁区安定化材2、3にも一部重な るごとく形成されている。また、先端電極5は、軟磁性 材1とその両側の磁区安定化材2、3を合わせた幅より もさらに広い幅を有し、図2に示された領域において軟 磁性材1の先端部1bおよび磁区安定化材2、3と接 し、紙面上方側から後端電極4側に向かって屈曲して延 在されている。

【0027】なお、上述した軟磁性材1を構成する材料 としては、従来公知の軟磁性材料がいずれも使用でき、 例えば、NiFe、NiFeCo、パーマロイ合金: N iFe-X (X=Ta, Cr, Nb, Rh, Zr, M o、Al、Au、Pd、Pt、Si等、Xとしてこれら の元素が複数種類含有されてもよい。)、CoZr系ア モルファス等が挙げられる。また、後端電極4および先 端電極5としては、Ta、Mo、W、Cr、Cu等、電 導性を有し且つ非磁性の金属材料が用いられる。

【0028】一方、磁区安定化材2、3は、軟磁性材1 の磁化方向Df を制御可能なバイアス磁界を発生できれ ば、硬磁性材料膜、軟磁性材料膜と硬磁性材料膜との積 層膜、反強磁性体膜、軟磁性材料膜と反強磁性体膜との 積層膜のいずれから構成されてもよい。硬磁性材料膜と しては、CoPt、CoNiPt、CoCrTa等より なる膜が挙げられる。また、反強磁性体膜としては、F eMn、NiMn、NiO、NiCoO等よりな膜が挙 げられる。なお、これら硬磁性材料膜や反強磁性体膜と 組み合わされる軟磁性材料膜としては、上述した軟磁性 材1と同様の材料が使用できる。

【0029】電極4、5を省略したMR素子10の断面 を図3に示すように、磁区安定化材2、3が硬磁性材料 膜である場合には、この硬磁性材料膜と軟磁性材1とが 強磁性結合し、軟磁性材1の磁化方向Dfが硬磁性材料 膜の磁化方向D。と同じ方向を向くようになる。

【0030】また、磁区安定化材2、3が軟磁性材料膜 と硬磁性材料膜との積層膜である場合、図4に示される ように、磁区安定化材2、3における軟磁性材料膜2 a、3aと軟磁性材1とが異なる材料より形成されても よいし、図5に示されるように、磁区安定化材2、3に おける軟磁性材料膜2a、3aと軟磁性材1とが共通の 2および第2の磁区安定化材3は、軟磁性材1の幅方向 50 材料にて一体的に形成されてもよい。いずれにしても、

硬磁性材料膜2b、3bと重なる領域における軟磁性材料膜2a、3aの磁化方向D。'が、該硬磁性材料膜2b、3bの磁化方向D。'が、該硬磁性材料膜2b、3bの磁化方向D。と同じ方向を向くようになれば、硬磁性材料膜2b、3bと重なっていない領域における軟磁性材料膜、即ち、軟磁性材1と称している領域の磁化方向Dfも、その両端の軟磁性材料膜2a、3aの磁化方向D。'と同じ方向を向くようになる。

【0031】磁区安定化材2、3が反強磁性体膜や、軟磁性材料膜と反強磁性体膜との積層膜よりなる場合も、 硬磁性材料膜や、軟磁性材料膜と硬磁性材料膜との積層 膜よりなる場合と同様である。

【0032】なお、図4、図5では、磁区安定化材2、3が積層膜である場合、磁区安定化材2、3における軟磁性材料膜2a、3aと軟磁性材1とが同じ厚さに形成されたものを示したが、これに限られず、図6に示されるように、磁区安定化材2、3の積層膜全体の厚みと軟磁性材1の厚みとが等しくなるように形成されてもよい。

【0033】また、本実施の形態に係るMR素子10に 20 おいては、磁区安定化材2、3の電気抵抗R。が、軟磁性材1の電気抵抗R症が大きくなるように構成される。ここでは、磁区安定化材2、3のセンス電流iの流入方向における長さは軟磁性材1と同じであるため、(磁区安定化材2、3を構成する材料の抵抗率 $\rho_{\rm p}$)/(センス電流iの流入方向に垂直な断面における磁区安定化材2、3の断面積 $s_{\rm p}$)の値が、(軟磁性材1を構成する材料の抵抗率 $\rho_{\rm f}$)/(上述の断面における軟磁性材1の断面積 $s_{\rm f}$)の値よりも大きくなるように設定すればよい。 30

【0034】磁区安定化材2、3の電気抵抗R。を増大させるために断面積s。を小さくする場合、磁区安定化材2、3の幅や厚みを小さくすればよい。また、磁区安定化材2、3の電気抵抗R。を増大させるために抵抗率 ρ。を大きくする場合、元々抵抗率 ρ。が大きな材料を選択すればよいが、磁区安定化材2、3に対して選択的に不純物の導入を行ったり、選択的に酸化させたりしてもよい。

【0035】以上のような構成を有する本実施の形態に係るMR素子10においては、軟磁性材1の幅Wが0.5μmと非常に狭いものであるにも関わらず、磁区安定化材2、3のバイアス磁界によって、該軟磁性材1の磁化方向Dfが長手方向の静磁的な磁気異方性に打ち勝って幅方向を向くようになる。したがって、電極4、5間にセンス電流iを流した状態で、軟磁性材1の先端部1b側から外部磁界Hextを印加すれば、軟磁性材1の抵抗変化が生じ、電極4、5間の電圧変化として外部磁界Hextを検出できる。

【0036】ここで、実際に上述のMR素子10に、長 例するものであり、絶縁材6、7の幅wが大きいほど軟手方向に平行な方向から外部磁界Hext を印加したとき 50 磁性材1の磁区安定化が困難となるため、絶縁材6、7

の磁化を測定すると、図7に示されるように、ヒステリシスを有さない滑らかな磁化曲線が得られる。また、電気抵抗を測定すると、図8に示されるように、ヒステリシスを有さない滑らかな磁気抵抗曲線が得られる。これは、外部磁界Hext が印加されていない状態では、磁区安定化材2、3のバイアス磁界によって軟磁性材1の磁化方向Df が磁化容易軸方向De を向いているためである。

【0037】また、本実施の形態に係るMR素子10に おいては、磁区安定化材2、3の電気抵抗R,が、軟磁 性材1の電気抵抗R,が大きくなるように構成されてい るので、電流損失も抑制されている。

【0038】 第2の実施の形態

本実施の形態では、軟磁性材1への電流損失を抑制する ために軟磁性材1と磁区安定化材2、3との間に絶縁材 を介在させた。

【0039】図9および図10に、本実施の形態に係るMR素子20を示す。このMR素子20も、第1の実施の形態と同様、単層の軟磁性材1の幅方向の両端側に磁区安定化材2、3が配設され、また、軟磁性材1の長手方向の両端部1a、1bに重なるごとく電極4、5を備えている。しかし、本実施の形態に係るMR素子20においては、軟磁性材1と磁区安定化材2、3との間に第1の絶縁材6および第2の絶縁材7が介在されている点が第1の実施の形態と異なっている。

【0040】ここで、軟磁性材1は、第1の実施の形態にて説明したと同様のものであればよい。磁区安定化材2、3も、第1の実施の形態と同様、軟磁性材1の磁化方向Dfを制御するために、該軟磁性材1の幅方向に平30 行な成分を有するバイアス磁界を発生するものである。ここでも、磁区安定化材2、3は、軟磁性材1の後端部1aから先端部1bに亘る全領域に配設されており、また、その磁化方向Dpが軟磁性材1の幅方向と平行方向に向けられている。但し、本実施の形態においては、磁区安定化材2、3が、硬磁性材料よりなる単層膜に限られる。

【0041】電極4、5は、第1の実施の形態と同様の 材料、同様の延在方向にて形成すればよいが、その少な くとも一方が磁区安定化材2、3と非接触となされてい 40 る必要がある。ここでは、後端電極4が、軟磁性材1と その両側の絶縁材6、7とを合計した幅より狭い幅に て、磁区安定化材2、3に重ならないように形成されて いる。なお、先端電極5は、第1の実施の形態と同様、 磁区安定化材2、3と接している。

【0042】絶縁材6、7は、軟磁性材1と磁区安定化材2、3とを電気的に絶縁可能であれば、いずれの材料より構成されても構わない。なお、磁区安定化材2、3が誘起するバイアス磁界の大きさは、距離の3乗に反比例するものであり、絶縁材6、7の幅wが大きいほど軟磁性材1の磁区安定化が困難となるため、絶縁材6、7

の幅wは絶縁性を確保できる限り小さい方がよい。 【0043】以上のような構成を有するMR素子20においては、軟磁性材1と磁区安定化材2、3とが電気的に絶縁されているため、磁区安定化材2、3内にセンス電流iが流入することがなく、電流の損失が抑制される。

【0044】また、本実施の形態に係るMR素子20においても、磁区安定化材2、3のバイアス磁界によって軟磁性材1の磁化方向 D_f が制御されているため、安定した磁気抵抗特性が得られる。

【0045】なお、上述したMR素子20の変形例として、図11、図12に示されるようなMR素子30が挙げられる。図9、図10に示されたMR素子20においては、軟磁性材1の幅方向の両側のみに絶縁材6、7が設けられていたのに対し、図11、図12に示されるMR素子30においては、軟磁性材1の下側から、該軟磁性材1の幅方向の両側、磁区安定化材2、3の上側に亘って連続的に絶縁材8が設けられている。このような構成を有するMR素子30は、MR素子20に比して、製造工程の簡略化が図ることができる。

【0046】また、このMR素子30においては、磁区 安定化材2、3の上面が絶縁材8にて被覆されているため、後端電極4の幅が軟磁性材1の幅Wより大きくても、電極4、5と磁区安定化材2、3とが接触することがない。したがって、このようなMR素子30は、その 製造工程において、電極4のパターニングのマージンを 大きく確保できるという利点も有する。

【0047】第3の実施の形態

本実施の形態では軟磁性材1への電流損失を無視できるような構成を示す。

【0048】図13および図14に本実施の形態に係るMR素子40を示す。このMR素子40も、第1の実施の形態と同様、単層の軟磁性材1の幅方向の両端側に磁区安定化材2、3が配設され、軟磁性材1の長手方向の両端部1a、1bに電極4、5を備えている。しかし、本実施の形態に係るMR素子40においては、磁区安定化材2、3が、軟磁性材1の長手方向の両端部1a、1b近傍にのみ設けられている点が第1の実施の形態とは異なっている。

【0049】即ち、第1の磁区安定化材2は、軟磁性材1の側方のうち軟磁性材1と後端電極4との接触領域に対応する領域に設けられた後端側磁区安定化材11と、軟磁性材1と先端電極5との接触領域に対応する領域に設けられた先端側磁区安定化材12とからなる。また、第2の磁区安定化材3は、軟磁性材1の側方のうち軟磁性材1と後端電極4との接触領域に対応する領域に設けられた後端側磁区安定化材13と、軟磁性材1と先端電極5との接触領域に対応する領域に設けられた先端側磁区安定化材14とからなる。このため、磁区安定化材2、3は、軟磁性材1のうち電極45間の実質的に成

磁部となる領域には接触しない。なお、磁区安定化材2、3は、軟磁性材1の後端部1a側のみ、あるいは、 先端部1b側のみに設けられてもよいが、本実施の形態においては、軟磁性材1に十分なバイアス磁界を与える

10

においては、軟磁性材1に十分なハイアス磁界を与える ために、軟磁性材1の両端部1a、1b近傍にそれぞれ 磁区安定化材2、3設けた。

【0050】なお、軟磁性材1、磁区安定化材2、3、電極4、5を構成する材料は、第1の実施の形態と同様でよい。

【0051】以上のような構成を有する本実施の形態に係るMR素子40は、磁区安定化材2、3が軟磁性材1の感磁部に接触しないため、磁区安定化材2、3の電気抵抗Rp を増大させたり、軟磁性材1と磁区安定化材2、3との間に絶縁材を介在させたりせずとも、感磁部に供給されるセンス電流iには損失が生じない。また、本実施の形態に係るMR素子40においても、磁区安定化材2、3のバイアス磁界によって軟磁性材1の磁化方向Df が制御されるため、安定した磁気抵抗特性が得られる。

20 【0052】第4の実施の形態

ここで、第1の実施の形態に示されたMR素子10を縦型MRへッドに適用した例について図15を用いて説明する。

【0053】この縦型MRへッド50は、図1および図2に示されたようなMR素子10が下部磁気シールド21および上部磁気シールド22にて挟み込まれたものである。上部磁気シールド22は、磁気記録媒体との対向面付近で屈曲し、これにより、上部磁気シールド22と下部磁気シールド21間の距離が狭まるようになされている。なお、この上部磁気シールド22と下部磁気シールド21の先端部間の距離が磁気ギャップgとなる。

【0054】また、この縦型MRへッド50においては、軟磁性材1の長手方向が磁気記録媒体の信号記録面に対して垂直となるように、また、軟磁性材1の先端部1bが磁気記録媒体との対向面側となるように、MR素子10が配設される。さらに、この縦型MRへッド50においては、軟磁性材1における感磁部の上方に、該軟磁性材1と直交するごとくバイアス導体23が配されている。このバイアス導体23は、軟磁性材1にバイアス磁界を与えて、検出信号の直線性を高める働きをする。

【0055】なお、上述のような構成を有する縦型MR ヘッドは、Al2 03 - TiC等の非磁性材料からなる スライダー24上に配置されてなり、また、上部磁気シ ールド22上には保護膜25が設けられている。

【0056】以上のような構成を有する縦型MRヘッド 50は、MR素子10が外部磁界Hext によって抵抗変 化を起こすことを利用して、磁気記録媒体からの信号磁 界(外部磁界Hext)を検出することができる。

区安定化材14とからなる。このため、磁区安定化材 【0057】なお、この磁気ヘッド50において、実際 2、3は、軟磁性材1のうち電極4、5間の実質的に感 50 に軟磁性材1が信号磁界(外部磁界Hext)の影響を受 けるのは、磁気記録媒体との対向面50aに臨む先端部から、これより後方へ磁気ギャップgに相当する長さ程度までである。これに対して、ここで用いられているMR素子10は、磁区安定化材2、3が軟磁性材1の長手方向の全領域に配設されており、信号磁界(外部磁界Hext)の影響を受ける領域では、十分に軟磁性材1の磁化方向Dfが制御されている。したがって、このMR素子10を適用した磁気ヘッド50は、バルクハウゼンノイズを発生させることなく、良好な再生が可能となる。

【0058】なお、第1の実施の形態に係るMR素子1 10 0の代わりに、第2の実施の形態、第3の実施の形態に示したMR素子20、30、40を適用して磁気ヘッドを構成しても、同様に信号磁界を良好に再生可能なものとなる。

[0059]

【発明の効果】以上の説明からも明らかなように、本発明を適用すると、非常に狭い幅の軟磁性材に対しても、磁区の制御を適切に行うことができるようになる。したがって、単層の軟磁性材を用いた簡易な構造のMR素子で、優れた磁気抵抗特性を得ることができる。

【0060】そして、このMR素子を磁気ヘッドに適用すれば、バルクハウゼンノイズの発生が抑制され、良好な再生が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るMR素子の一構成例について要部を示す斜視図である。

【図2】図1のMR素子における軟磁性材および磁区安 定化材と電極との位置関係を上面側から示す模式図であ る。

【図3】磁区安定化材の一構成例を示すための断面図で 30 ある。

【図4】磁区安定化材の他の構成例を示すための断面図である

【図5】磁区安定化材の他の構成例を示すための断面図である。

【図6】磁区安定化材の他の構成例を示すための断面図である。

【図7】本発明のMR素子の磁化曲線を示す特性図である。

【図8】本発明のMR素子の磁気抵抗曲線を示す特性図 40

である。

【図9】本発明のMR素子の他の構成例について要部を示す斜視図である。

12

【図10】図9のMR素子における軟磁性材および磁区 安定化材と電極との位置関係を上面側から示す模式図で ある。

【図11】本発明のMR素子の他の構成例について要部を示す斜視図である。

【図12】図11のMR素子における軟磁性材および磁 区安定化材と電極との位置関係を上面側から示す模式図 である。

【図13】本発明のMR素子の他の構成例について要部を示す斜視図である。

【図14】図13のMR素子における軟磁性材および磁 区安定化材と電極との位置関係を上面側から示す模式図 である。

【図16】従来のMR素子の構成例について要部を示す 斜視図である。

【図17】図16のMR素子の磁化曲線を示す特性図で 20 ある。

【図18】図16のMR素子の磁気抵抗曲線を示す特性 図である。

【図19】従来のMR素子の他の構成例について要部を示す斜視図である。

【図20】図19のMR素子の磁化曲線を示す特性図である。

【図21】図19のMR素子の磁気抵抗曲線を示す特性図である。

【図22】図19のMR素子の軟磁性材の幅を狭くした場合に得られる磁気抵抗曲線を示す特性図である。

【図23】図19のMR素子の要部断面図である。

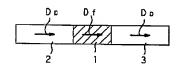
【図24】図19のMR素子における各軟磁性材の磁化容易軸方向D。と実際の磁化方向Df を模式的に示す斜視図である。

【符号の説明】

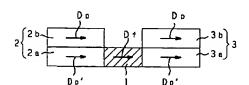
1 軟磁性材、 2 第1の磁区安定化材、 3 第2 の磁区安定化材、 4後端電極、 5 先端電極、 D e 磁化容易軸方向、 Df 軟磁性材の磁化方向、

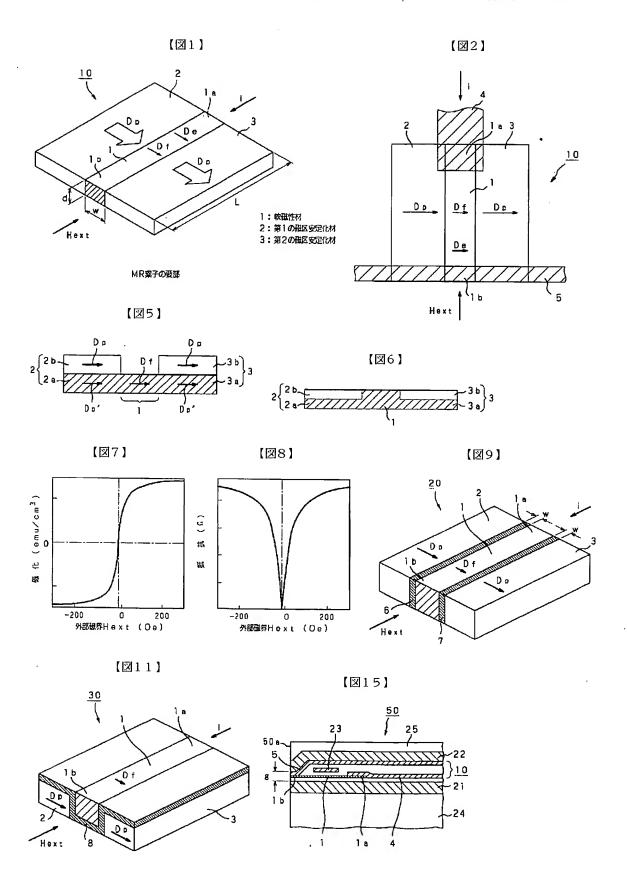
D_p 磁区安定化材の磁化方向

【図3】

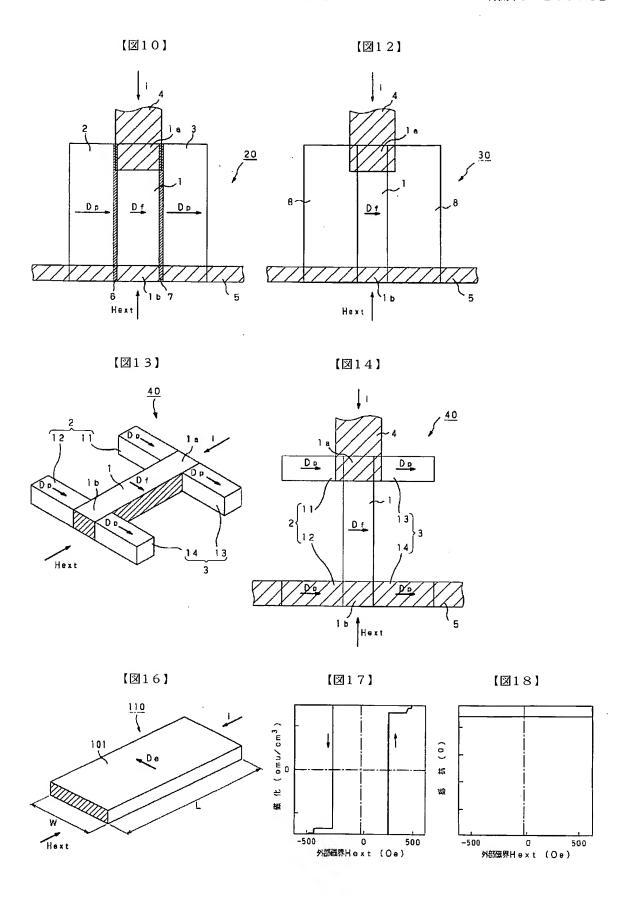


【図4】

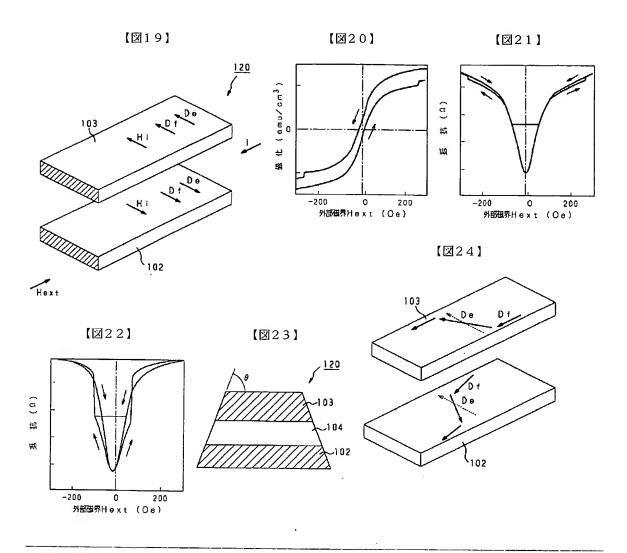




5/9/06, EAST Version: 2.0.3.0



5/9/06, EAST Version: 2.0.3.0



【手続補正書】

【提出日】平成8年8月2日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図面の簡単な説明

【補正方法】変更

【補正内容】

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るMR素子の一構成例について要部を示す斜視図である。

【図2】図1のMR素子における軟磁性材および磁区安定化材と電極との位置関係を上面側から示す模式図である。

【図3】磁区安定化材の一構成例を示すための断面図である。

【図4】磁区安定化材の他の構成例を示すための断面図である。

【図5】磁区安定化材の他の構成例を示すための断面図

である。

【図6】磁区安定化材の他の構成例を示すための断面図である。

【図7】本発明のMR素子の磁化曲線を示す特性図である。

【図8】本発明のMR素子の磁気抵抗曲線を示す特性図である。

【図9】本発明のMR素子の他の構成例について要部を 示す斜視図である。

【図10】図9のMR素子における軟磁性材および磁区 安定化材と電極との位置関係を上面側から示す模式図で ある。

【図11】本発明のMR素子の他の構成例について要部を示す斜視図である。

【図12】図11のMR素子における軟磁性材および磁 区安定化材と電極との位置関係を上面側から示す模式図 である。 【図13】本発明のMR素子の他の構成例について要部を示す斜視図である。

【図14】図13のMR素子における軟磁性材および磁 区安定化材と電極との位置関係を上面側から示す模式図 である。

【図15】本発明のMR素子を適用した縦型MRヘッドを示す断面図である。

【図16】従来のMR素子の構成例について要部を示す 斜視図である。

【図17】図16のMR素子の磁化曲線を示す特性図である。

【図18】図16のMR素子の磁気抵抗曲線を示す特性 図である。

【図19】従来のMR素子の他の構成例について要部を示す斜視図である。

【図20】図19のMR素子の磁化曲線を示す特性図である。

【図21】図19のMR素子の磁気抵抗曲線を示す特性図である。

【図22】図19のMR素子の軟磁性材の幅を狭くした場合に得られる磁気抵抗曲線を示す特性図である。

【図23】図19のMR素子の要部断面図である。

【図24】図19のMR素子における各軟磁性材の磁化容易軸方向De と実際の磁化方向Df を模式的に示す斜視図である。

【符号の説明】

1 軟磁性材、 2 第1の磁区安定化材、 3 第2の磁区安定化材、 4後端電極、 5 先端電極、 D。 磁化容易軸方向、 Df 軟磁性材の磁化方向、

D_p 磁区安定化材の磁化方向

フロントページの続き

(72)発明者 鹿野 博司

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内